## Влияние диффузии Те из подложки n-GaSb: Те на свойства твердых растворов GaInAsSb, выращенных в присутствии свинца

© Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, А.Ф. Липаев, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко<sup>¶</sup>, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия

(Получена 3 августа 2004 г. Принята к печати 19 августа 2004 г.)

Исследовано влияние диффузии Те из подложки n-GaSb: Те на транспортные и фотоэлектрические свойства твердых растворов GaInAsSb, выращенных из содержащих свинец растворов-расплавов. Показано, что наибольшее влияние диффузии Те из подложки наблюдается в эпитаксиальных слоях твердых растворов толщиной 1-2 мкм. В данных образцах при освещении их светом в области собственного поглощения возникает большой сигнал фотоэдс.

#### 1. Введение

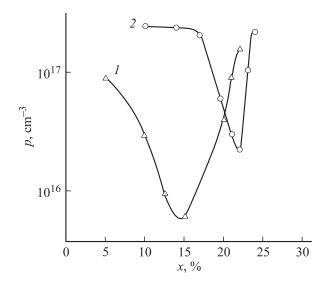
В работах [1,2] было показано, что при выращивании нелегированных эпитаксиальных слоев (толщиной до 5 мкм) твердых растворов  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ (0 < x < 0.22, 0 < y < 0.18) на подложках *n*-GaSb: Te в процессе роста происходит диффузия теллура из подложки. При этом теллур действует двояко: с одной стороны, создает мелкие донорные уровни, а с другой — наряду с присущими твердому раствору GaInAsSb акцепторными уровнями с энергией активации  $E_{A1} = 0.035$  эВ и  $E_{A2} = 0.07$  эВ, обусловленными природными дефектами, создает новый акцепторный уровень с энергией активации  $E_{A3} = 0.1$  эВ, связанный с образованием структурного дефекта  $V_{\rm Ga}$ Те. Было также установлено, что примесь Те, диффундирующего из подложки, сильно уменьшает подвижность дырок в твердом растворе, приводит к возрастанию поперечного ( $\mathbf{H} \perp \mathbf{j}$ , ј — вектор плотности тока в образце) магнитосопротивления  $\left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^{\perp}$  (при этом коэффициент магнитосопротивления  $B_r = \left(\frac{\Delta \rho}{a}\right)^{\perp} / \left(\frac{\mu H}{c}\right)^2 > 1$ ), возникновению продольного (**H**  $\parallel$  **j**) магнитосопротивления  $\left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^{\parallel}$ , к появлению отрицательной фотопроводимости и долговременной релаксации фотопроводимости. Эти явления могут быть объяснены существованием в материале неоднородно распределенных заряженных центров, возникающих в результате диффузии теллура и приводящих к образованию кластерных скоплений. Таким образом, теллур, диффундирующий из подложки, изменяет свойства твердых растворов GaInAsSb.

#### 2. Результаты исследований

Исследование свойств выращенных **без использования свинца** твердых растворов  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$  в зависимости от состава показало [1,2], что при содержании индия x=0.15 в таких твердых растворах наблюдается

минимум концентрации дырок (рис. 1, кривая I), обусловленный, по-видимому, возрастанием степени компенсации из-за уменьшения концентрации комплекса дефектов  $V_{\rm Ga}{\rm Ga}_{\rm Sb}$  с энергиями активации  $E_{A1}$  и  $E_{A2}$ . Именно в таких твердых растворах с x=0.15 влияние диффузии Те из подложки наиболее заметно.

В таких образцах при освещении их светом кроме фотопроводимости возникает большой сигнал фотоэдс (ФЭДС). Для увеличения чувствительности при измерении фотосигналов спектральные исследования проводились с использованием модулированного освещения образца. Возникающий при этом переменный сигнал регистрировался селективным усилителем и синхронным детектором на входе. Изучение ФЭДС проводилось для двух типов образцов: твердые растворы p-Ga<sub>1-x</sub>In<sub>x</sub>As<sub>y</sub>Sb<sub>1-y</sub> (x = 0.15), которые выращивались на подложках n-GaSb: Те с дополнительным изолирующим подслоем p-GaSb и без него. Спектральные зависимости ФЭДС, измеренные при T = 80 и 300 K, представлены на рис. 2. Длинноволновая граница кривых соответ-

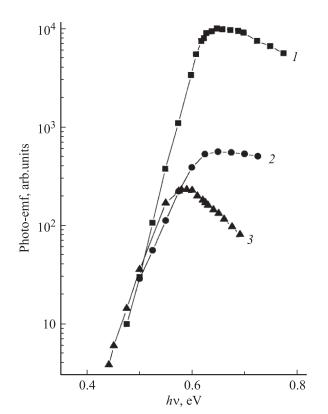


**Рис. 1.** Зависимости концентрации дырок от содержания индия (x) в твердых растворах  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ : I — без нейтрального растворителя Pb, 2 — в присутствии Pb.

<sup>¶</sup> E-mail: parkhomen@mail.ioffe.ru

	Наличие подслоя	r	Тол- щина, мкм	300 K				77 K							ФЭДС,	
				Тип прово- димости	$\sigma$ , $Om^{-1}cm^{-1}$	<i>R</i> , см <sup>3</sup> /Кл	$\mu_{300}$ , $cm^2/(B\cdot c)$	Тип прово- димости	$\sigma$ , $Om^{-1}cm^{-1}$	<i>R</i> , см <sup>3</sup> /Кл	$\mu_{77}$ , $cm^2/(B \cdot c)$	$B_r$	<i>Е<sub>Аі</sub></i> , эВ	$K = \frac{N_D}{N_A}$	усл. 300 K	<del></del>
1	Есть	0.18	1.7	p	120	4.68	562	p	115	20.8	2400	1.0	0.023 0.07	0.1	3	5
2	Нет	0.18	5.0	p	46	5.6	233	p	14	26	366	5.2	0.02 0.06 0.11	0.61	11	25
3	Нет	0.18	2.0	n	_	_	2940	p	11	14.4	157	11.8	0.023 0.067	0.65	14	307
4	Есть	0.215	1.7	p	51	1.08	55	p	2.8	137.5	385		0.03 0.07	0.84	8	26
5	Нет	0.215	1.7	n	_	_	3330	n	_	_	450	_	_	_	11	360

ствует краю собственного поглощения. Ширина запрещенной зоны материала составляет  $E_g=0.606$  эВ при T=80 К. Появление небольшой ФЭДС при T=80 К в образце с изолирующим подслоем ( $p_{77}=6\cdot 10^{15}$  см $^{-3}$ ,  $\mu_{77}=1950$  см $^2/({\rm B\cdot c})$  — рис. 2, кривая 2) связано с неоднородным распределением компенсирующих примесей и структурных дефектов в твердом растворе с x=0.15. Выращивание твердых растворов без изолирующего подслоя из-за диффузии Те из подложки



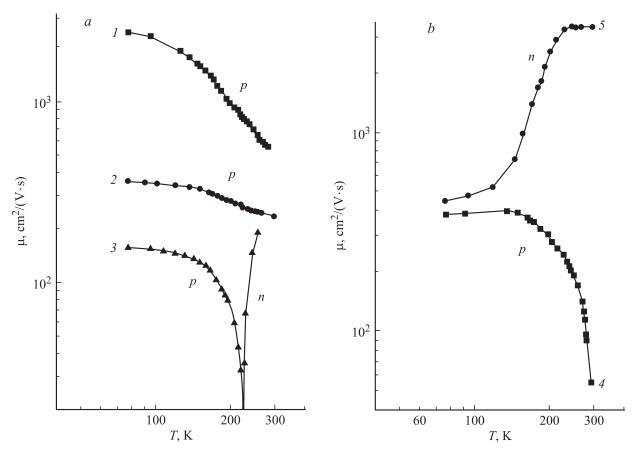
**Рис. 2.** Спектральные зависимости фотоэдс в твердых растворах  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$  (x=0.15), выращенных без использования свинца: I, I, I — без изолирующего подслоя, I — с изолирующим подслоем. I, I — I = 80 K; I — I = 300 K.

в слой приводит к образованию структурного дефекта  $V_{\text{Ga}}$ Те. Данный дефект представляет собой неоднородно распределенные заряженные центры, образующие кластерные скопления, что и создает значительные потенциальные барьеры в объеме полупроводника. В образце без дополнительного изолирующего подслоя  $(p_{77} = 3.3 \cdot 10^{16} \,\mathrm{cm}^{-3}, \ \mu_{77} = 377 \,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{B} \cdot \mathrm{c})$  — puc. 2, кривая 1) — там, где была возможна диффузия Те сигнал ФЭДС возрастал более чем на порядок. Это можно объяснить существованием в материале значительных энергетических барьеров, разделяющих избыточные носители заряда полем. Следует отметить, что сигнал ФЭДС с ростом температуры падает на порядок (рис. 2, кривые 1 и 3) в результате уменьшения объема и высоты потенциальных барьеров, а также усиления термической ионизации центров.

Далее рассмотрим результаты исследований влияния Те, продиффундировавшего из подложки *n*-GaSb: Те, на транспортные и фотоэлектрические свойства эпитаксиальных слоев твердых растворов GaInAsSb, выращенных из **содержащих свинец** растворов-расплавов, и приведем сравнение со свойствами твердых растворов, выращенных на подложке *n*-GaSb: Те без использования свинца.

Свинец играет важную роль в получении твердых растворов  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$  в области составов с x>0.22, так как позволяет получать твердые растворы с высоким содержанием индия в твердой фазе x=0.22-0.27 [3]. Такие твердые растворы имеют ширину запрещенной зоны  $E_g=0.49-0.52$  эВ  $(T=300~{\rm K})$  и могут быть использованы для создания оптоэлектронных приборов в области длин волн  $\lambda=2.3-2.7~{\rm MKM}$ .

В работе [3] нами было показано, что в твердых растворах  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ , выращенных из свинцовых растворов-расплавов на подложках n-GaSb: Те с дополнительным изолирующим подслоем p-GaSb (подслой с параметрами  $p=6\cdot 10^{14}~{\rm cm}^{-3}$  при  $T=77~{\rm K}$ ,  $\rho\gtrsim 400~{\rm CM}\cdot{\rm CM}$  был получен из свинцового растворарасплава), минимум концентрации дырок наблюдается



**Рис. 3.** Температурные зависимости подвижности носителей тока для твердых растворов  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ , полученных в присутствии свинца: a-x=0.18, b-x=0.215. Номера кривых соответствуют номерам образцов в таблице.

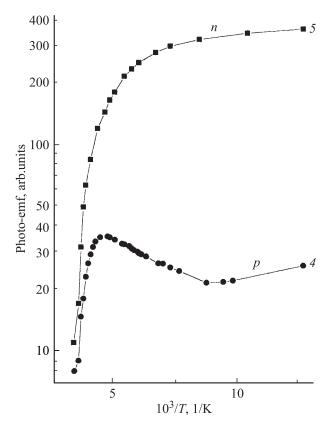
при содержании In x=0.22 (рис. 1, кривая 2). Принимая во внимание подобие зависимостей I и 2 на этом рисунке, мы ожидаем, что при выращивании твердых растворов  $\mathrm{Ga}_{1-x}\mathrm{In}_x\mathrm{As}_y\mathrm{Sb}_{1-y}$  из свинцовых раствороврасплавов Те, диффундирующий из подложки, будет оказывать наибольшее влияние на свойства материала в области составов с  $x\approx0.22$ .

Рассмотрим, как влияет Те из подложки на свойства твердых растворов  $\mathrm{Ga}_{1-x}\mathrm{In}_x\mathrm{As}_y\mathrm{Sb}_{1-y}$  с x=0.18 и 0.215, выращенных с использованием свинца. Были исследованы две группы образцов: эпитаксиальные слои твердых растворов, выращенные на дополнительном изолирующем подслое (образцы 1 и 4, см. таблицу), и слои, выращенные непосредственно на подложке n-GaSb: Те (образцы 2, 3, 5). Измерялись электропроводность  $(\sigma)$ , коэффициент Холла (R), подвижность  $(\mu)$ , поперечное магнитосопротивление  $\left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)^{\perp}$  и  $\Phi$ ЭДС при температурах T=77-300 К. Результаты измерений приведены в таблице и на рис. 3 и 4.

Как видно из таблицы, для твердого раствора с x=0.18 в образце 1 имеет место высокая подвижность дырок  $\mu_{77}=2400\,\mathrm{cm^2/(B\cdot c)}$ , обусловленная рассеянием на ионах примеси и колебаниях решетки. Температурная зависимость коэффициента Холла позволяет определить в данном материале уровни с энергиями активации

 $E_{A1}=0.023$  эВ и  $E_{A2}=0.07$  эВ. Магнитосопротивление в образце 1 невелико:  $B_r=\left(\frac{\Delta\rho}{\rho}\right)^\perp/\left(\frac{\mu H}{c}\right)^2=1$ ; продольное магнитосопротивление отсутствует; ФЭДС практически отсутствует.

Совсем другая картина наблюдается для того же твердого раствора с содержанием индия x = 0.18, но выращенного без дополнительного подслоя, когда теллур диффундирует из подложки в твердый раствор. Если толщина образца 5 мкм (образец 2), то диффузия теллура происходит не на всю толщину слоя. При этом образец сохраняет р-тип проводимости, но значения подвижности меньше, чем в образце 1 как при 77, так и при 300 K (рис. 3, a, ср. кривые 2 и 1). Поперечное магнитосопротивление  $\left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^{\perp}$  возрастает, при этом  $B_r = \left(\frac{\Delta \rho}{\rho}\right)^{\perp}/\left(\frac{\mu H}{c}\right)^2$  достигает 5 и появляется ФЭДС. Все эти эффекты указывают на существование крупных неоднородностей, возникших из-за проникновения теллура из подложки в эпитаксиальный слой. Самые существенные изменения свойств твердого раствора  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ (x = 0.18, дополнительный подслой отсутствует) наблюдаются, когда толщина слоя составляет ~ 2 мкм (образец 3). В данном случае Те проникает на всю глубину слоя, создавая крупные кластерные скопления. Из-за высокой степени компенсации тип проводимости



**Рис. 4.** Температурные зависимости фотоэдс для твердого раствора  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$  (x=0.215): 4 — с изолирующим подслоем; 5 — без изолирующего подслоя. Номера кривых соответствуют номерам образцов в таблице.

изменяется с дырочного на электронный при  $T > 200 \,\mathrm{K}$ . В таких образцах наблюдается очень большая ФЭДС, достигающая 307 усл.ед. при  $T = 77 \,\mathrm{K}$  (см. таблицу). Данная величина намного больше, чем в таких же образцах, выращенных с дополнительным подслоем.

Рассмотрим твердые растворы  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$  с содержанием индия x = 0.215 (толщина слоев  $\sim 1.7$  мкм), выращенные из свинцовых растворов-расплавов как на дополнительном изолирующем подслое (образец 4), так и непосредственно на подложке n-GaSb:Те (образец 5). В образце 4 (рис. 3, b, кривая 4) тип проводимости – дырочный, однако подвижность значительно ниже, чем в образце 1 с x = 0.18, выращенном на дополнительном подслое (рис. 3, a, кривая 1). Это связано с тем, что при  $x \approx 0.22$  наблюдается максимум степени компенсации, что приводит к сильной неоднородности материала (рис. 1, кривая 2). Из температурной зависимости коэффициента Холла можно определить энергии активации  $E_{A1} = 0.03$  эВ и  $E_{A2} = 0.07$  эВ. ФЭДС в образце 4 составляла при  $T = 77 \,\mathrm{K} \, 26 \,\mathrm{усл.ед.}$ , а при  $T = 300 \,\mathrm{K} \,$ — 8 усл.ед.

Для твердых растворов GaInAsSb с содержанием индия x = 0.215, выращенных непосредственно на подложке n-GaSb:Те (образец 5), тип проводимости — электронный при 77 < T < 300 К. Подвижность при

 $T=77\,\mathrm{K}$  равна  $\mu_{77}=450\,\mathrm{cm}^2/(\mathrm{B\cdot c})$ , а при температурах выше 150 K наблюдался резкий рост холловской подвижности из-за перехода к собственной проводимости (рис. 3, b, кривая 5). ФЭДС при  $T<150\,\mathrm{K}$  составляла 360 усл.ед. (рис. 4, кривая 5). При повышении температуры ФЭДС медленно уменьшалась, а затем резко падала и при  $T=300\,\mathrm{K}$  составляла 11 усл.ед. Такой ход температурной зависимости объясняется наличием в образце потенциальных барьеров, которые понижаются с повышением температуры, а также из-за усиления термической ионизации центров.

Важно отметить, что такие большие значения  $\Phi$ ЭДС наблюдались только в образцах, выращенных без дополнительного подслоя (рис. 4, кривая 5). В образцах, выращенных с дополнительным подслоем,  $\Phi$ ЭДС была на порядок ниже (рис. 4, кривая 4).

#### 3. Заключение

Исследовано влияние диффузии теллура из подложки n-GaSb:Те на электрические и фотоэлектрические свойства твердых растворов  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$ , выращенных как без использования свинца (x=0.15), так и из растворов-расплавов, содержащих свинец (x=0.18) и (x=0.18) и (x=0.18)

Получены следующие результаты.

- 1. Наибольшее влияние диффузии теллура из подложки наблюдается в твердых растворах  $Ga_{1-x}In_xAs_ySb_{1-y}$  с содержанием индия x=0.15, изготовленных без использования свинца, и с x=0.215, полученных в присутствии свинца, обладающих низкими концентрацией и подвижностью дырок.
- 2. Диффузия теллура из подложки n-GaSb: Те в твердые растворы  $\mathrm{Ga}_{1-x}\mathrm{In}_x\mathrm{As}_y\mathrm{Sb}_{1-y}$ , выращенные без дополнительного подслоя, приводит к возникновению большой  $\Phi$ ЭДС при освещении образцов светом в области собственного поглощения. Наибольший сигнал  $\Phi$ ЭДС наблюдался при  $T=77\,\mathrm{K}$  в тонких образцах с x=0.15, выращенных без использования свинца, и с x=0.215 в присутствии свинца.

Наблюдаемый эффект возникновения ФЭДС требует подробного исследования, так как может представлять интерес для изготовления высокочувствительных фотоэлементов.

### Список литературы

- [1] А.Н. Баранов, А.Н. Дахно, Б.Е. Джуртанов, Т.С. Лагунова, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев. ФТП, **24**, 98 (1990).
- [2] А.Н. Баранов, Т.И. Воронина, А.Н. Дахно, Б.Е. Джуртанов, Т.С. Лагунова, М.А. Сиповская, Ю.П. Яковлев. ФТП, 24, 1072 (1990).
- [3] Т.И. Воронина, Т.С. Лагунова, Е.В. Куницына, Я.А. Пархоменко, Д.А. Васюков, Ю.П. Яковлев. ФТП, 35, 941 (2001).

Редактор Т.А. Полянская

# Influence of the tellurium diffusion from a n-GaSb: Te substrate on properties of GaInAsSb solid solutions grown from lead-containing melts

T.I. Voronina, T.S. Lagunova, A.F. Lipaev, E.V. Kunitsyna, Ya.A. Parkhomenko, M.A. Sipovskaya, Yu.P. Yakovlev

Ioffe Physicotechnical Institute, Russian Academy of Sciences, 194021 St. Petersburg, Russia

**Abstract** The influence of tellurium diffusion from a n-GaSb:Te substrate on transport and photoelectric properties of GaInAsSb solid solutions grown from lead-containing melts has been investigated for the first time. It is shown, that the strongest influence of the tellurium diffusion from the substrate is observed in epitaxial layers of  $1-2\mu m$  of thickness solid solutions having both low hole concentration and low hole mobility. In these samples a high photo-emf signal has been observed under light illumination in the region of the bandgap absorption.